

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2014 年 11 月 6 日(06.11.2014)



(10) 国際公開番号

WO 2014/178270 A1

- (51) 国際特許分類:
C08G 69/26 (2006.01) C08G 59/50 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2014/060346
- (22) 国際出願日: 2014 年 4 月 9 日(09.04.2014)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2013-095708 2013 年 4 月 30 日(30.04.2013) JP
特願 2013-095705 2013 年 4 月 30 日(30.04.2013) JP
- (71) 出願人: 三菱瓦斯化学株式会社(MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC.) [JP/JP]; 〒1008324 東京都千代田区丸の内二丁目 5 番 2 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 枋原 健也(TOCHIHARA, Tatsuya); 〒9503121 新潟県新潟市北区松浜町 3 5 0 0 番地 三菱瓦斯化学株式会社 新潟工場内 Niigata (JP). 篠原 克巳(SHINOHARA, Katsumi); 〒9503121 新潟県新潟市北区松浜町 3 5 0 0 番地 三菱瓦斯化学株式会社 新潟工場内 Niigata (JP). 中村 宜史(NAKAMURA, Takashi); 〒9503121 新潟県新潟市北区松浜町 3 5 0 0 番地 三菱瓦斯化学株式会社 新潟工場内 Niigata (JP). 山田 元(YAMADA, Hajime); 〒9503121 新潟県新潟市北区松浜町 3 5 0 0 番地 三菱瓦斯化学株式会社 新潟工場内 Niigata (JP). 三田寺 淳(MITADERA, Jun); 〒2540016 神奈川県平塚市東八幡 5 丁目 6 番 2 号 三菱瓦斯化学株式会社 平塚研究所内 Kanagawa (JP).
- (74) 代理人: 大谷 保(OHTANI, Tamotsu); 〒1050001 東京都港区虎ノ門三丁目 2 5 番 2 号 ブリヂストン虎ノ門ビル 6 階 特許業務法人大谷特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーロパ (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: XYLYLENEDIAMINE COMPOSITION, AND METHOD FOR PRODUCING POLYAMIDE RESIN

(54) 発明の名称: キシリレンジアミン組成物及びポリアミド樹脂の製造方法

(57) Abstract: [1] A xylylenediamine composition comprising xylylenediamine and bis(methylbenzyl)amine, wherein the content of bis(methylbenzyl)amine is 0.0005 to 0.1 part by mass relative to 100 parts by mass of xylylenediamine; and [2] a method for producing a polyamide resin, which comprises a step of introducing a diamine containing xylylenediamine, a dicarboxylic acid and bis(methylbenzyl)amine in an amount of 0.0005 to 0.1 part by mass relative to 100 parts by mass of the xylylenediamine into a reaction system to carry out a polycondensation reaction.

(57) 要約: [1] キシリレンジアミンとビス(メチルベンジル)アミンとを含有するキシリレンジアミン組成物であって、ビス(メチルベンジル)アミンの含有量がキシリレンジアミン100質量部に対し0.0005~0.1質量部であるキシリレンジアミン組成物、及び[2] キシリレンジアミンを含有するジアミン、ジカルボン酸、及び、該キシリレンジアミン100質量部に対して0.0005~0.1質量部のビス(メチルベンジル)アミンを反応系に導入し、重縮合反応を行う工程を有する、ポリアミド樹脂の製造方法である。



WO 2014/178270 A1